



中華民國專利證書

發明第 I 334059 號

發明名稱：正負雙型磁性光阻劑微影製程

專利權人：國立台灣大學

發明人：林唯芳、陳永芳、吳明忠、莊智閔、黃裕清

專利權期間：自2010年12月1日至2026年4月27日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局

局長 王美花

